



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 101906666 A

(43) 申请公布日 2010. 12. 08

(21) 申请号 201010125989. 0

(22) 申请日 2010. 03. 17

(71) 申请人 中南大学

地址 410083 湖南省长沙市麓山南路 1 号

(72) 发明人 马运柱 刘文胜 李静 唐芳

(74) 专利代理机构 中南大学专利中心 43200

代理人 胡奕

(51) Int. Cl.

C30B 29/62 (2006. 01)

C30B 29/52 (2006. 01)

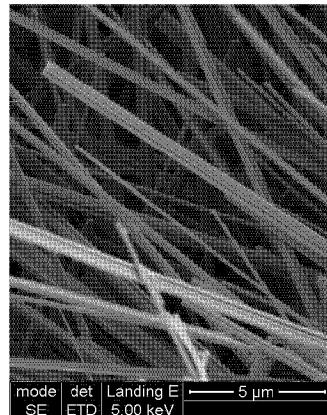
权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 1 页

(54) 发明名称

一种微 / 纳米钨晶须 / 线 / 棒的制备方法

(57) 摘要

本发明公开了一种微 / 纳米钨晶须 / 线 / 棒的制备方法，取纯细钨粉，配置占混合物总重 5~15wt% 的镍、铁和钴金属粉末其中的一种或两种或三种，球磨混合均匀，取混合粉，平铺于不锈钢舟皿中；或把纯细钨粉置于 Mo、Si 或 SiC 薄片表面，而后平铺于不锈钢舟皿中；把不锈钢舟推入还原炉中，确保不锈钢舟置于还原炉高温正中位置；关紧炉门，通入氮气和氢气，其中 N₂:H₂ 流量比为 8~12:1，氮气先通入 80℃ 的去离子水中，然后再引入炉中；按 2~5℃ /min 速度使还原炉从室温升至 500℃；按 2℃ /min 升温速度，使炉温从 500℃ 升至 800℃，而后保温 4~6 小时；反应完成后等炉温降至室温，取出产物，经乙醇清洗、过滤、烘干，可得均匀分布的微 / 纳米钨晶须 / 线 / 棒。本发明的方法反应温度低、反应时间短，易于控制，产量较高，是一种较好的批量生产钨晶须 / 线 / 棒的方法。



1. 一种微 / 纳米钨晶须 / 线 / 棒的制备方法, 取纯细钨粉, 配置占混合物总重 5~15wt% 的镍、铁和钴金属粉末其中的一种或两种或三种, 球磨混合均匀, 取混合粉, 平铺于不锈钢舟皿中 ; 把不锈钢舟推入还原炉中, 确保不锈钢舟置于还原炉高温正中位置 ; 关紧炉门, 通入氮气和氢气, 其中 $N_2 : H_2$ 流量比为 8~12 : 1, 氮气先通入 80°C 的去离子水中, 然后再引入炉中 ; 按 2~5°C / min 速度使还原炉从室温升至 500°C ; 按 2°C / min 升温速度, 使炉温从 500°C 升至 800°C, 而后保温 4~6 小时 ; 反应完成后等炉温降至室温, 取出产物, 经乙醇清洗、过滤、烘干, 可得均匀分布的微 / 纳米钨晶须 / 线 / 棒。

2. 一种微 / 纳米钨晶须 / 线 / 棒的制备方法, 取纯细钨粉, 置于 Mo 薄片或 Si 薄片或 SiC 薄片表面, 而后平铺于不锈钢舟皿中 ; 把不锈钢舟推入还原炉中, 确保不锈钢舟置于还原炉高温正中位置 ; 关紧炉门, 通入氮气和氢气, 其中 $N_2 : H_2$ 流量比为 8~12 : 1, 氮气先通入 80°C 的去离子水中, 然后再引入炉中 ; 按 2~5°C / min 速度使还原炉从室温升至 500°C ; 按 2°C / min 升温速度, 使炉温从 500°C 升至 800°C, 而后保温 4~6 小时 ; 反应完成后等炉温降至室温, 取出产物, 经乙醇清洗、过滤、烘干, 可得均匀分布的微 / 纳米钨晶须 / 线 / 棒。

3. 如权利要求 1 所述的方法, 其特征在于 : 纯细钨粉中配置占混合物总重 7wt% 的镍和铁金属粉末。

4. 如权利要求 1~3 之一所述的方法, 其特征在于 : 所述 $N_2 : H_2$ 流量比为 10 : 1。

一种微 / 纳米钨晶须 / 线 / 棒的制备方法

技术领域

[0001] 本发明属于粉末冶金领域晶须的制备,尤其是钨晶须 / 线 / 棒的制备方法。

背景技术

[0002] 晶须 / 线 / 棒是一种近乎无缺陷的材料,比金属材料具有更优越的性能,钨晶须 / 线 / 棒就表现出优异的机械性能,其杨氏模量可达到约 400GPa,抗拉强度高达 32.8GPa。作为结构材料,用钨晶须 / 纳米线来补强增韧难熔合金、陶瓷材料等,可以显著增强材料的韧性和强度。作为功能材料,钨晶须 / 纳米线具有优良的场发射性能和气体电离性能,可用于制作场发射电器、平面显示器以及气体电离器。

[0003] Lee Y H 等在 Appl Phys Lett (2002, 81 (4) :745) 上报道:利用钨膜的自催化作用制得了直径为 10 ~ 50nm、表面光滑的高纯钨纳米线。Vaddiraju S 等在 J Am Chem Soc (2003, 125 (36) :10792) 上报道:有氧条件下,加热使得基底的温度高于钨的氧化物分解温度(约 1450°C),钨在基底上的化学气相传输能够促使纯钨纳米线的形成。Karabacak TanSEL 等在 Appl Phys Lett (2003, 83 (15) :3096) 上报道:采用直流磁控溅射装置,用被氧化的 p-Si(100) 作基底,纯度为 99.95% 的 W 作阴极,基底倾斜,与靶材表面呈 87° 夹角,在 Si 基底旋转的情况下,制得了具有四个(110) 晶面的简单立方单晶 β-W(100) 纳米棒。高程等在材料研究学报 (2008, 22(6) :577) 报道:以 WO₃ 粉末为原料,以单晶硅片为基底,在还原管式炉内中得到<111> 方向长度为 15 μm、直径为 150nm 的钨线。Guha Sumit 等在 Materials and Manufacturing Processes (1994, 9(6) :1061) 上报道:用 Al₂O₃ 作生长基体,通过 WF₆ 热分解的方法制得了直径为 1~2 μm,长度达几百微米 (100~500) 的钨晶须。Starliper A.G 等在 Electro-deposition and Surface Treatment (1974, 2(4) :249) 上报道:采用在真空炉中用 H₂ 还原 WC₁₆ 的方法,在 2700~3300°C 的温度下,获得了平均直径为 3~4 μm,长径比约为 1000,抗拉强度为 2.067~2.756 × 103 MPa 的针状钨晶须。Nataliya F 等在 J Phys Chem C (2008, 112 (47) :18455) 上报道:950°C,用 CO 还原 NiWO₄,得到了截面为六角形、长度为 10~50 μm、直径为 0.2~0.3 μm 的笔直的钨晶须。徐剑等在材料研究学报 (2006, 20(6) :576) 报道:先把钨的合金粉末 900°C 氧化得到氧化物,而后再还原,制备出了顶部直径为 30~70nm,根部直径为 150~200nm,长度为 2~10 μm 的表面光滑、笔直的金属钨线。Guise O L 等在 Nano Letter (2002, 2(3) :191) 上报道:以直径为 0.38mm 的钨丝为原料,采用两步法对钨丝进行电化学蚀刻最终获得了直径为 5nm 甚至更小的钨尖。张友生等在电子显微学报 (2004, 23(4) :483) 上报道:采用电化学腐蚀法得到了纳米级钨针尖,得到了直径约 100nm,长约 2 μm 的钨针尖。LiYadong 等在 Angew Chem (2002, 114(2) :343) 报道:用钨酸钠 (Na₂WO₄) 和十六烷基三甲基溴化铵在水热条件下反应,合成了层状介孔物质 WO-L,在管式还原炉中对其进行 VPC 处理,制得了直径为 20~80nm、长度从几 μm 到 30 μm 的沿着(110)晶面生长的 bcc 结构的钨单晶纳米线。Thong 等在 Appl Phys Lett (2002, 81 (25) :4823) 上报道:用有机金属化合物 W(CO)₆ 作为先驱物,将场发射电流控制在 100nA,制得了直径为 3~4nm,长度达几微米的钨纳米线。Mitsubishi K 等在 Appl Phys Lett (2003,

83 (10) :2064)报道:用W(CO)₆作为前驱体,用能够发射高能电子束的亚纳米级探针来制备纳米材料,得到了直径小到3.5nm的钨纳米线。最近,Liu Z Q等在Nanotechnology (2004, 15 (5) :414)用STEM电子束诱导沉积的方法在C膜上制得了钨纳米线。

发明内容

[0004] 本发明旨在探索一种简捷的微 / 纳钨晶须 / 线 / 棒的制备新方法,以实现规模化生产。

[0005] 本发明的技术方案为:取纯细钨粉,配置占混合物总重5~15wt%的镍、铁或钴金属粉末其中的一种或两种或三种,球磨混合均匀,取混合粉,平铺于不锈钢舟皿中;或把纯细钨粉置于Mo、Si或SiC薄片表面,而后平铺于不锈钢舟皿中;把不锈钢舟推入还原炉中,确保不锈钢舟置于还原炉高温正中位置;关紧炉门,通入氮气和氢气,其中N₂:H₂流量比为8~12:1,氮气先通入80℃的去离子水中,然后再引入炉中;按2~5℃/min速度使还原炉从室温升至500℃;按2℃/min升温速度,使炉温从500℃升至800℃,而后保温4~6小时;反应完成后等炉温降至室温,取出产物,经乙醇清洗、过滤、烘干,可得均匀分布的微 / 纳钨晶须 / 线 / 棒。

[0006] 采用本发明制备的钨晶须形态好,可制得长径比为5~200的钨晶须 / 棒,还可得到直径小于100nm且均匀分布的钨纳米线。本发明反应温度低、反应时间短,易于控制,产量较高,产品形态好且均匀分布,是一种较好的批量生产钨晶须 / 线 / 棒的方法。

附图说明

[0007] 本发明实施例1所制备的微 / 纳钨晶须 / 线 / 棒的SEM图。

具体实施方式

[0008] 实施例1:

称取200g纯钨粉,钨粉粒度为2~5μm,配置7wt%的镍和铁金属粉末,球磨混合均匀。混入镍和铁金属粉末的作用在于诱导钨晶须的生长。取混合粉2.0g,平铺于清洗后的不锈钢舟皿中,把不锈钢舟推入内径为60mm的管式还原炉中,确保不锈钢舟置于还原炉高温正中位置,关紧炉门,通入氮气和氢气。其中N₂流量为0.3L/min,H₂流量为0.03L/min,氮气经加入去离子水的三口烧瓶引入炉中,三口烧瓶放置在电热套中。按3℃/min速度升温还原炉,使炉子从室温升至500℃。打开电热套电源,设置80℃温度,使去离子水缓慢升至80℃(此温度控制水蒸气流量)。按2℃/min升温速度,使炉温从500℃升至800℃,而后保温6小时。反应完成后等炉温降至室温,打开炉门取出产物,经乙醇清洗、过滤、烘干,即得到均匀分布的微 / 纳钨晶须 / 线 / 棒,产物形态好,晶须 / 棒长径比为5~200,其中可见少量直径小于100nm且均匀分布的钨纳米线。

[0009] 实施例2:

称取粒度2~5μm的纯钨粉2.0g,置于Mo薄片表面(诱导钨晶须的生长),而后平铺于清洗后的不锈钢舟皿中,把不锈钢舟推入内径为60mm的管式还原炉中,确保不锈钢舟置于还原炉高温正中位置,关紧炉门,通入氮气和氢气,其中N₂流量为0.3L/min,H₂流量为0.03L/min,氮气经加入去离子水的三口烧瓶引入炉中,三口烧瓶放置在电热套中。按4℃/min速

度升温还原炉，使炉子从室温升至 500℃，打开电热套电源，设置 80℃ 温度，使去离子水缓慢升至 80℃（此温度控制水蒸气流量）。按 2℃ /min 升温速度，使炉温从 500℃ 升至 800℃，而后保温 6 小时，反应完成后等炉温降至室温，打开炉门取出产物，经乙醇清洗、过滤、烘干，可得均匀分布的微 / 纳钨晶须 / 线 / 棒，产物形态好，晶须 / 棒长径比为 5~200，其中可见少量直径小于 100nm 且均匀分布的钨纳米线。

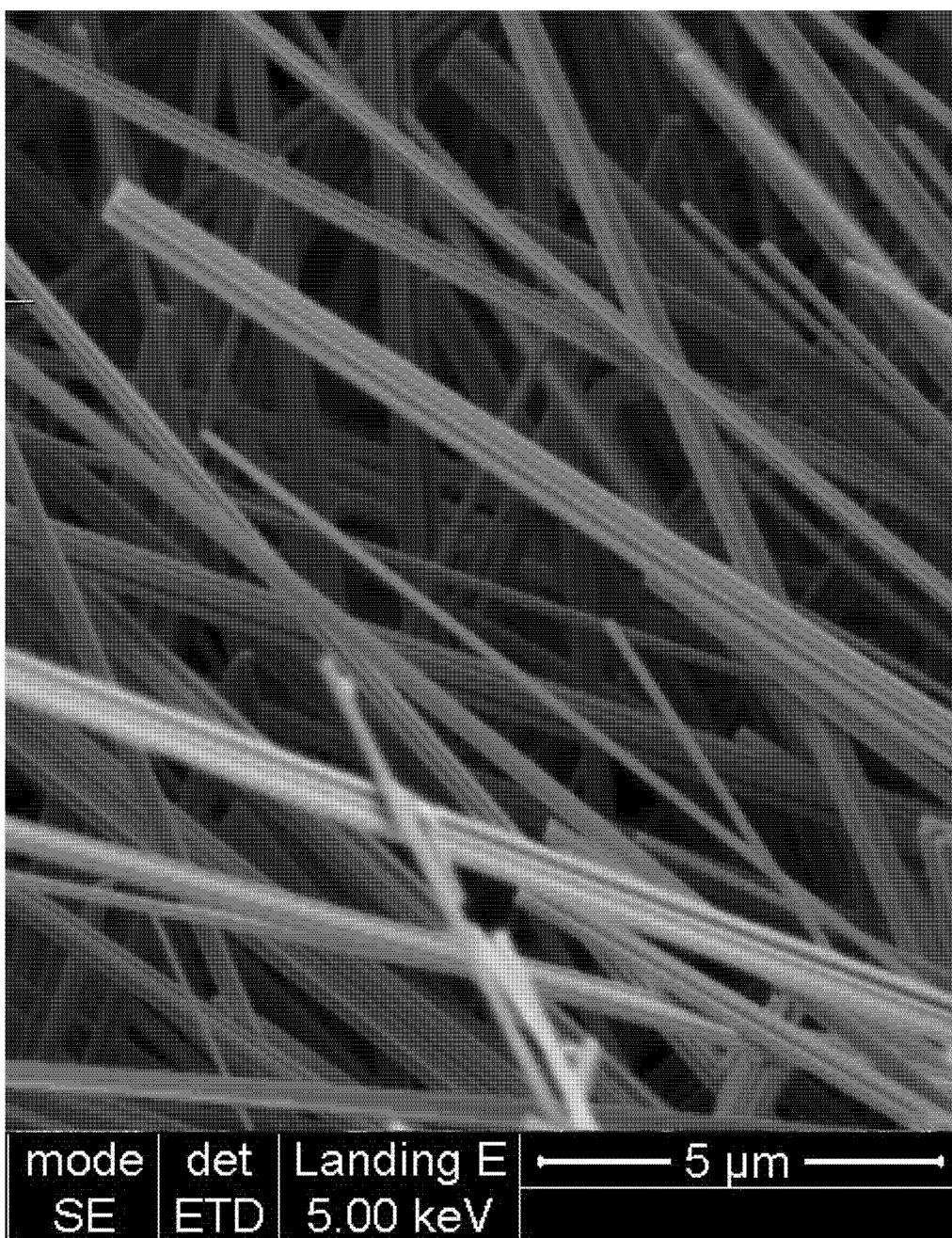


图 1